

Semiconduttori

Bande di energia

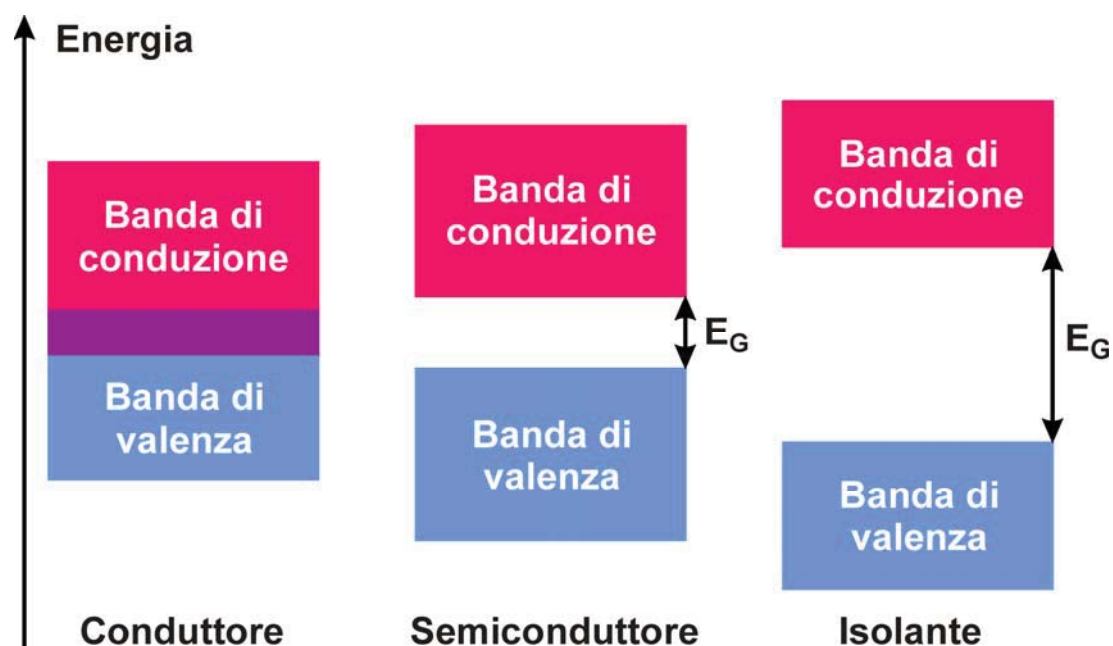
- Un cristallo è formato da atomi disposti in modo da costituire una struttura periodica regolare
- Quando gli atomi formano un cristallo, il moto degli elettroni dello strato più esterno è modificato rispetto a quanto avviene per un atomo isolato
 - ◆ gli elettroni non sono più legati a un singolo atomo ma sono condivisi tra più atomi
 - ◆ i livelli energetici permessi formano delle bande costituite da un numero molto elevato di livelli vicini tra loro
- Il moto degli elettroni degli strati più interni non è influenzato in modo apprezzabile dalla presenza degli altri atomi
 - ◆ si può assumere che il nucleo e gli elettroni degli strati più interni complessivamente costituiscano degli ioni positivi

Banda di conduzione e di valenza

- Ad ogni livello energetico permesso può corrispondere un numero finito di stati dinamici diversi
- In base al **principio di esclusione di Pauli** in ogni stato dinamico si può trovare al più un solo elettrone
- Alla temperatura $T = 0 \text{ K}$ gli elettroni occupano tutti gli stati permessi che corrispondono ai livelli energetici più bassi disponibili
- La banda di energia più elevata che in queste condizioni è occupata da elettroni è detta **banda di valenza**
- La prima banda al di sopra della banda di valenza è detta **banda di conduzione**

3

Banda di conduzione e di valenza



4

Conduttori e isolanti

- In un **conduttore** la banda di valenza e la banda di conduzione sono parzialmente sovrapposte
 - ◆ In presenza di un campo elettrico esterno gli elettroni possono acquisire energia e muoversi liberamente all'interno del cristallo
- In un **isolante** la banda di valenza e la banda di conduzione sono separate da una banda proibita (**gap**) di ampiezza E_G relativamente elevata (dell'ordine di alcuni elettronvolt, $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$)
 - ◆ Un campo elettrico esterno non è in grado di trasferire gli elettroni dalla banda di valenza alla banda di conduzione
 - ◆ All'aumentare della temperatura, la probabilità che un elettrone acquisti un'energia sufficiente a portarlo nella banda di conduzione è trascurabile

5

Semiconduttori

- In un **semiconduttore** l'ampiezza della banda proibita è relativamente piccola (dell'ordine di 1 eV)
 - ◆ Es: a 0 K per il silicio $E_G = 1.17 \text{ eV}$, per il germanio $E_G = 0.743 \text{ eV}$
- Un campo elettrico esterno non è in grado di trasferire elettroni nella banda di conduzione,
 - ◆ $T = 0 \text{ K}$ il materiale si comporta come un isolante
- Per $T > 0 \text{ K}$ un certo numero di elettroni (crescente con T) può acquisire energia sufficiente per trasferirsi nella banda di conduzione
 - ◆ In presenza di un campo elettrico si può avere una corrente
 - ◆ La conducibilità risulta inferiore a quella dei conduttori e aumenta all'aumentare della temperatura
- Come si vedrà in seguito, il comportamento di un semiconduttore può essere sensibilmente influenzato dalla presenza di impurità nel cristallo
- Un semiconduttore sufficientemente puro da non risentire di questi effetti è detto **intrinseco**

6

Materiali semiconduttori

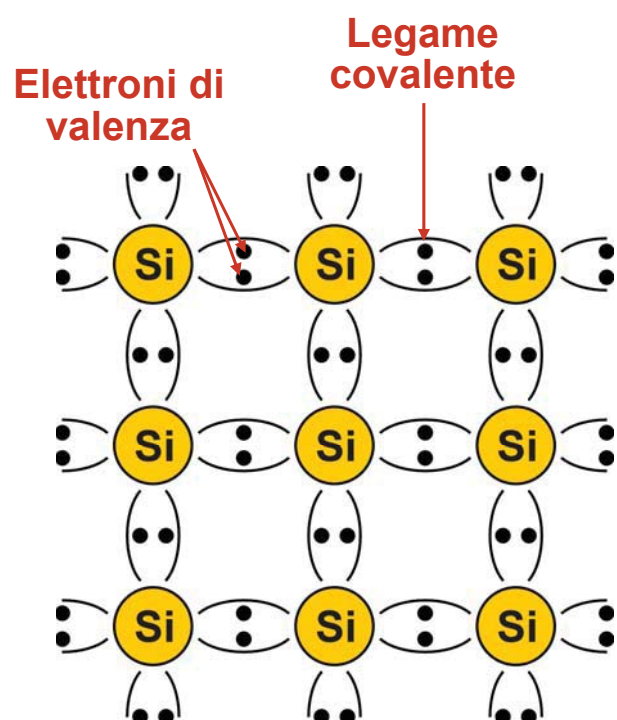
- Oltre agli elementi semiconduttori (silicio e germanio) esistono anche semiconduttori composti
- Questi ultimi, in prevalenza, sono formati da combinazioni di elementi dei gruppi IIIA e VA (es. GaAs) o dei gruppi IIB e VIA (es. CdS)
- I semiconduttori composti sono impiegati in applicazioni particolari (es. dispositivi optoelettronici e dispositivi per alta frequenza)
- Il germanio è stato utilizzato per realizzare i primi transistor
- Attualmente il materiale più diffuso, su cui si basa quasi interamente la produzione dei circuiti integrati, è il silicio
- Per questo motivo in seguito si farà riferimento solo al silicio

	IIIA	IVA	VA	VIA
	5 B	6 C	7 N	8 O
	13 Al	14 Si	15 P	16 S
IIB	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As
	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb
	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi
			84 Po	

7

Silicio intrinseco

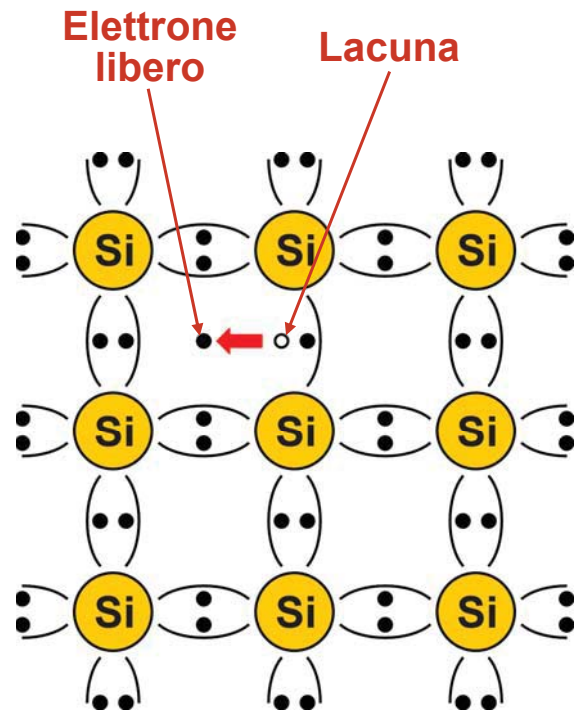
- Un atomo di silicio ha 4 elettroni nello strato più esterno (**elettroni di valenza**)
- In un cristallo di silicio ciascuno di questi elettroni viene condiviso con uno degli atomi più vicini
- Una coppia di elettroni condivisi dà origine a un **legame covalente**
- In questo modo per ogni atomo viene riempito completamente lo strato più esterno, che può contenere 8 elettroni



8

Elettroni e lacune

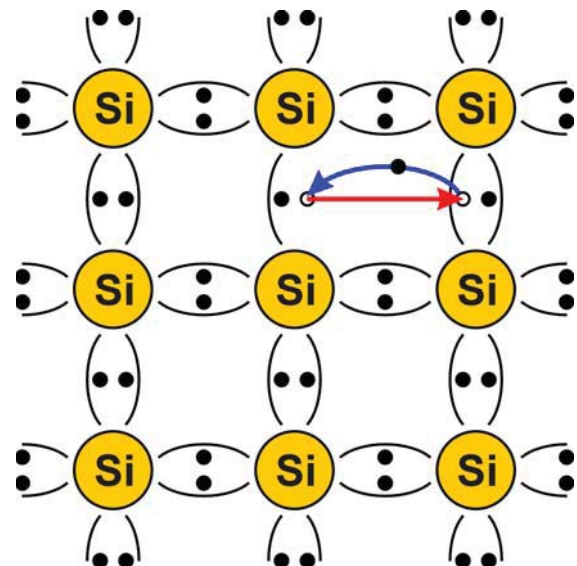
- Per $T = 0\text{ K}$ tutti gli elettroni di valenza sono legati a coppie di atomi
- ➔ Non ci sono elettroni disponibili per dare luogo a correnti elettriche
- All'aumentare di T un certo numero di elettroni può acquistare l'energia sufficiente per rompere il legame e quindi può muoversi liberamente nel cristallo
- In questo modo un legame rimane incompleto
- ➔ Si forma una **lacuna**



9

Movimento di una lacuna

- In presenza di un legame incompleto è possibile che un elettrone di un atomo vicino vada ad occupare la lacuna
- In questo modo viene prodotta una nuova lacuna nell'atomo da cui proviene l'elettrone
- Successivi spostamenti di elettroni di valenza producono un movimento della lacuna attraverso il cristallo
- La lacuna si comporta come una particella dotata di carica positiva, uguale in valore assoluto a quella dell'elettrone, libera di muoversi attraverso il cristallo



10

Generazioni e ricombinazioni

- In un cristallo di silicio, per effetto dell'agitazione termica si ha una continua **generazione** di coppie elettrone-lacuna
 - ◆ Il tasso di generazione è funzione della temperatura
- All'aumentare delle concentrazioni di elettroni liberi e lacune aumenta la probabilità che un elettrone libero vada ad occupare una lacuna
- Questo processo è detto **ricombinazione** e determina la scomparsa di un elettrone libero e di una lacuna
 - ◆ Il tasso di ricombinazione è funzione della temperatura e della concentrazione di elettroni e lacune
- In condizioni di equilibrio termico le generazioni e le ricombinazioni si bilanciano
- ➔ La concentrazione di elettroni (liberi), n , e la concentrazione di lacune, p , sono uguali tra loro e costanti e dipendono solo dalla temperatura

$$p = n = n_i$$

n_i = **concentrazione intrinseca**
Per il silicio, per $T = 300$ K si ha $n_i \approx 1.45 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$

11

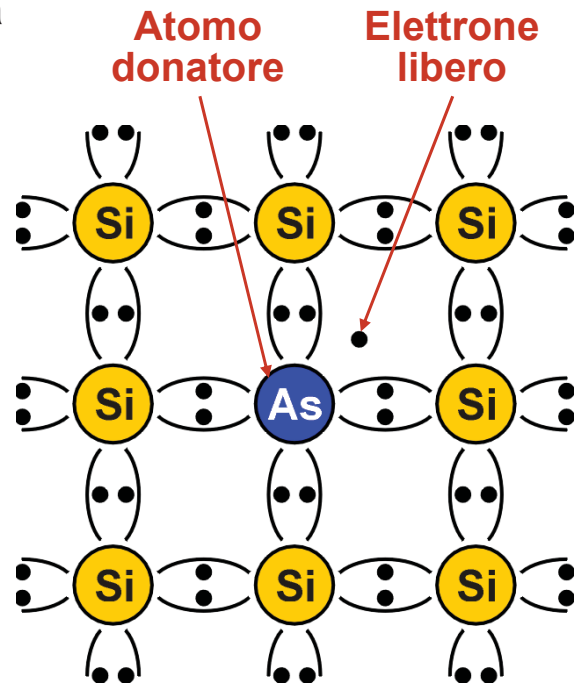
Accettori e donatori

- Le concentrazioni degli elettroni e delle lacune possono essere modificate con l'introduzione nel cristallo di impurità sostituzionali (cioè atomi di elementi diversi che si sostituiscono ad alcuni degli atomi di silicio)
 - ◆ Questo procedimento è detto **drogaggio**
- Ci sono due categorie di elementi droganti
 - ◆ Gli elementi del gruppo IIIA (boro, alluminio, indio, gallio, ...), che hanno 3 elettroni di valenza, sono detti **accettori** e determinano un incremento della concentrazione di lacune
 - Il silicio drogato con elementi accettori è detto di **tipo p**
 - ◆ Gli elementi del gruppo VA (fosforo, arsenico, antimonio ...), che hanno 5 elettroni di valenza, sono detti **donatori** e determinano un incremento della concentrazione di elettroni
 - Il silicio drogato con elementi donatori è detto di **tipo n**

12

Silicio di tipo n

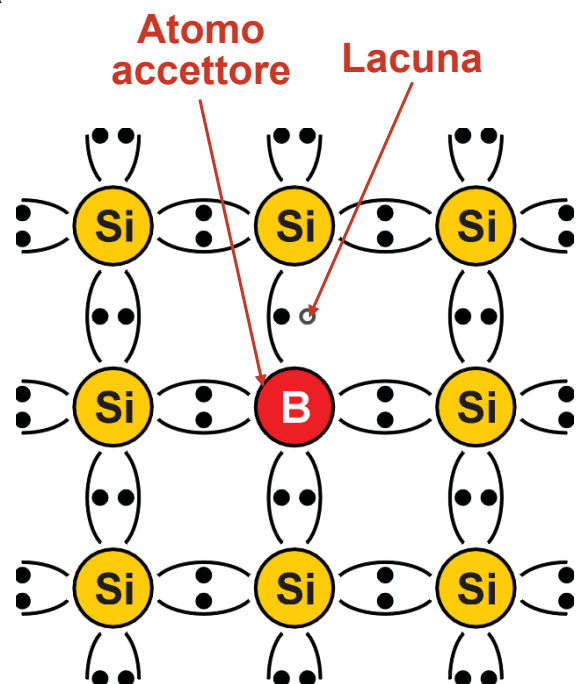
- Alcuni atomi di silicio sono sostituiti da atomi di un elemento pentavalente (es. arsenico)
- 4 degli elettroni di valenza degli atomi donatori formano legami covalenti
- Il quinto elettrone risulta debolmente legato all'atomo donatore
- ➔ Alle temperature ordinarie può acquistare energia sufficiente a renderlo libero
- ➔ Incremento del numero di elettroni liberi senza generazione di lacune
- ➔ L'atomo donatore cede un elettrone, quindi diviene uno ione positivo



13

Silicio di tipo p

- Alcuni atomi di silicio sono sostituiti da atomi di un elemento trivalente (es. boro)
- I tre elettroni di valenza degli atomi accettori formano altrettanti legami covalenti
- Manca un elettrone per completare il quarto legame
- ➔ Si ha una lacuna che può essere occupata da un elettrone di valenza di un atomo vicino
- ➔ Incremento del numero di lacune senza generazione di elettroni liberi
- ➔ L'atomo accettore acquista un elettrone, quindi diviene uno ione negativo



14

Concentrazione delle cariche

- Affinché i droganti caratterizzino il cristallo come di tipo p o di tipo n, occorre che la loro concentrazione sia grande rispetto alla concentrazione intrinseca n_i
 - ➔ Le concentrazioni dei droganti non sono mai inferiori a 10^{13} - 10^{14} cm⁻³
- Non è possibile introdurre nel silicio impurità sostituzionali con concentrazioni superiori a 10^{19} - 10^{20} cm⁻³ (limite di solubilità)
 - ➔ Questo limite rappresenta il valore massimo che possono assumere le concentrazioni dei droganti
- In un cristallo di tipo n, con valori della concentrazione dei donatori N_D compresi in questo intervallo, si ha
$$n \approx N_D$$
- Analogamente in un cristallo di tipo p, se la concentrazione degli accettori è N_A , risulta
$$p \approx N_A$$

15

Concentrazione delle cariche

- Si può dimostrare che in un cristallo drogato il prodotto delle concentrazioni degli elettroni e delle lacune non dipende dalle concentrazioni dei droganti, ma assume sempre lo stesso valore che si ha nel silicio intrinseco (**legge dell'azione di massa**)
$$pn = n_i^2$$
- Di conseguenza in un cristallo n la concentrazione delle lacune
$$p \approx \frac{n_i^2}{N_D}$$
quindi risulta molto minore della concentrazione intrinseca
- Analogamente, in un cristallo p, la concentrazione di elettroni è
$$n \approx \frac{n_i^2}{N_A}$$
- ➔ In un cristallo n gli elettroni sono detti **cariche maggioritarie** mentre le lacune sono dette **cariche minoritarie**, in un cristallo p le lacune sono le cariche maggioritarie e gli elettroni le cariche minoritarie

16

Corrente di deriva

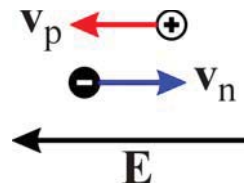
- In presenza di un campo elettrico esterno \mathbf{E} , le lacune sono accelerate nella direzione del campo e gli elettroni nella direzione opposta
- Dato che le cariche mobili sono soggette ad un'azione frenante dovuta alle interazioni con il reticolo cristallino, le loro velocità risultano proporzionali al campo elettrico
- Quindi le velocità degli elettroni e delle lacune sono date, rispettivamente dalle relazioni

$$\mathbf{v}_p = \mu_p \mathbf{E}$$

$\mu_p =$ **mobilità delle lacune**

$$\mathbf{v}_n = -\mu_n \mathbf{E}$$

$\mu_n =$ **mobilità degli elettroni**



- Le mobilità diminuiscono all'aumentare della temperatura e della concentrazione dei droganti
- In pratica, per il silicio, si può assumere che il loro valore coincida con quello del semiconduttore intrinseco fino a concentrazione dell'ordine di 10^{15} cm^{-3}

17

Corrente di deriva

- Le lacune e gli elettroni, per effetto del campo elettrico esterno, danno luogo ad una corrente (**corrente di deriva**) la cui densità è

$$\mathbf{J} = q(p\mu_p + n\mu_n)\mathbf{E}$$

dove q è la carica dell'elettrone ($q = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$)

- Dato che la densità di corrente è legata al campo elettrico dalla relazione

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

si riconosce che l'espressione della conducibilità è

$$\sigma = q(p\mu_p + n\mu_n)$$

18

Esempio

- Per il silicio intrinseco alla temperatura di 300 K si ha

$$\mu_p = 480 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$$

$$\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$$

$$n = p = n_i = 1.45 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

➡ quindi

$$\sigma = q(p\mu_p + n\mu_n) \approx 4.3 \times 10^{-6} (\Omega \cdot \text{cm})^{-1} \Rightarrow \rho = \frac{1}{\sigma} \approx 2.4 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm}$$

- Per il silicio tipo n con $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ a 300 K (assumendo che le mobilità siano invariate rispetto al silicio intrinseco) si ha

$$n \approx N_D = 10^{15}$$

$$p \approx n_i^2/N_D = 2 \times 10^5 \text{ cm}^{-3}$$

➡ quindi

$$\sigma = q(p\mu_p + n\mu_n) \approx 0.22 (\Omega \cdot \text{cm})^{-1} \Rightarrow \rho = \frac{1}{\sigma} \approx 4.6 \Omega \cdot \text{cm}$$

19

Corrente di diffusione

- Se nel cristallo la densità degli elettroni o delle lacune non è costante, l'agitazione termica determina un movimento di cariche dalle regioni a concentrazione maggiore verso quelle a concentrazione minore
- Si ha quindi una corrente (**corrente di diffusione**) la cui densità è proporzionale al gradiente della concentrazione delle cariche

20